

平成31年度 ナノテクキャリアアップアライアンス
京都大学 電子線描画装置入門コース

■目的：

近年、微細加工技術で大いに注目を集めているのが MEMS・NEMS 技術であり、既に様々な分野で研究・開発・実用化が進んでいます。特に、センサ・情報通信・医療・バイオなどの分野で著しい発展をとげています。この技術の中で、微細構造作製におけるキープロセスのひとつが、電子線描画です。

本コースにおいては、微細加工の初心者を対象にし、最新鋭電子線描画装置を使用した Si ウェハへの描画をメインに、Si ドライエッチング装置による微細加工や FE-SEM による加工後の微細構造観察も含め、微細加工のための基本技術習得を目指します。

■募集人数： 3名

■期間： 平成31年7月22日（月）～ 8月1日（木）
講義：2日間（全員）、実習：2日間（個別） 合計4日間

■会場：

京都大学ナノテクノロジーハブ拠点
京都市左京区吉田本町 京都大学吉田キャンパス内 工学部物理系校舎3階327号
<http://www.nanoplat.cpier.kyoto-u.ac.jp/access/>

■内容：

1日目、2日目 7月22日（月）～ 7月23日（火）

① 電子線描画の基礎（講義） 参加者全員が対象

*以下の日程は受講者毎に連続した2日間を実施します。参加者により日程が異なりますのでご注意ください。
具体的な受講日程は、受講決定後、調整します。

3日目 7月24日（水）、7月29日（月）、7月31日（水） の何れかの日

② CADによるパターン設計（実習）
③ 基板準備と電子線描画装置による描画（実習）

4日目 7月25日（木）、7月30日（火）、8月1日（木） の何れかの日

④ 描画パターンの現像（実習）
⑤ Si ドライエッチング加工（実習）
⑥ 加工構造の FE-SEM 観察（実習）

■受講料： 14,000円

■問合せ・申込先：

京都大学ナノ・マイクロシステム工学研究室内 CUPAL 事務局
(cupal@nms.me.kyoto-u.ac.jp、電話：075-383-3693)